

碱抛光优化剂 BPL-719系列



减重窗口大
不同减重效率基本一致
减重窗口大，易操控

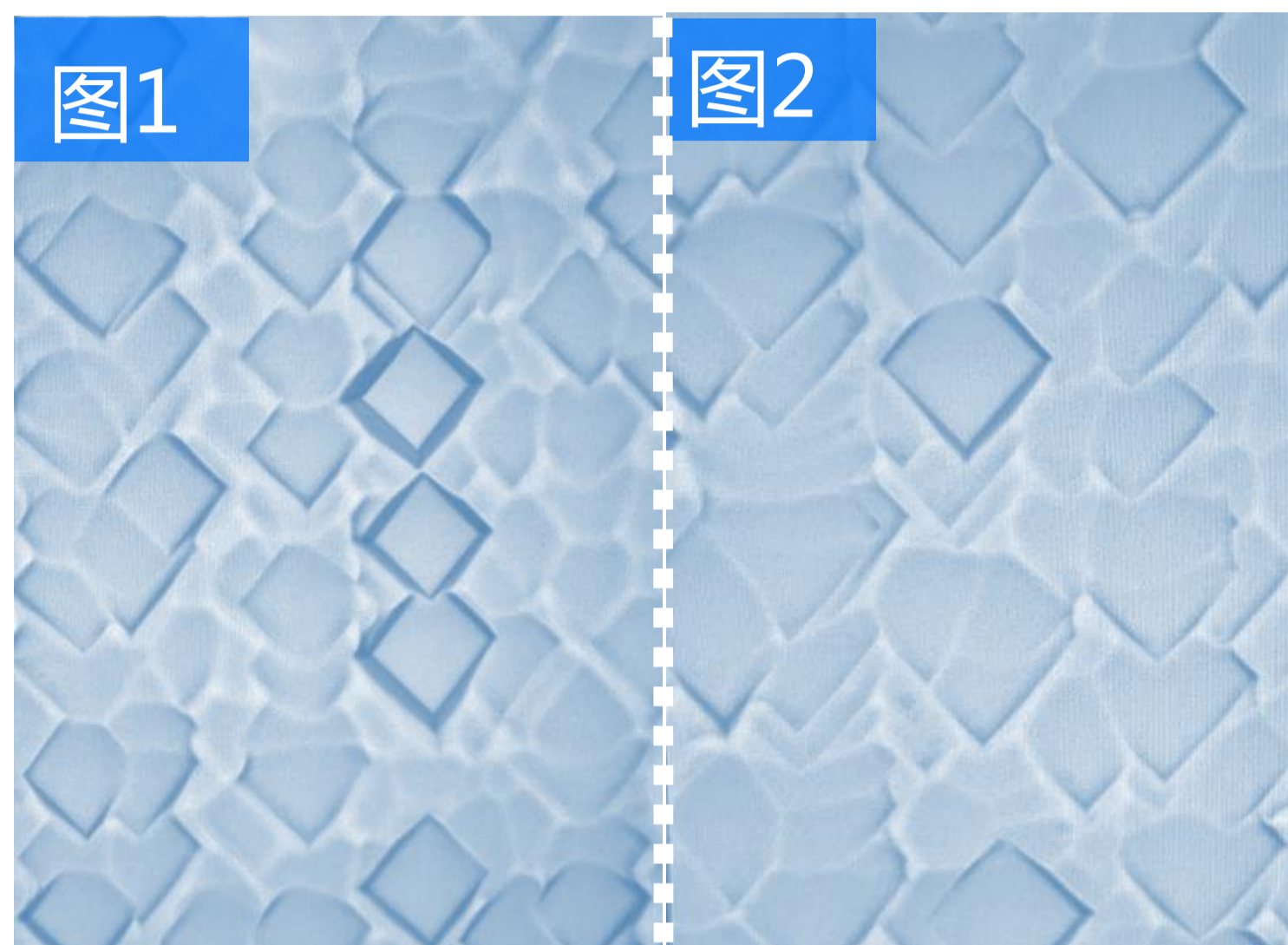
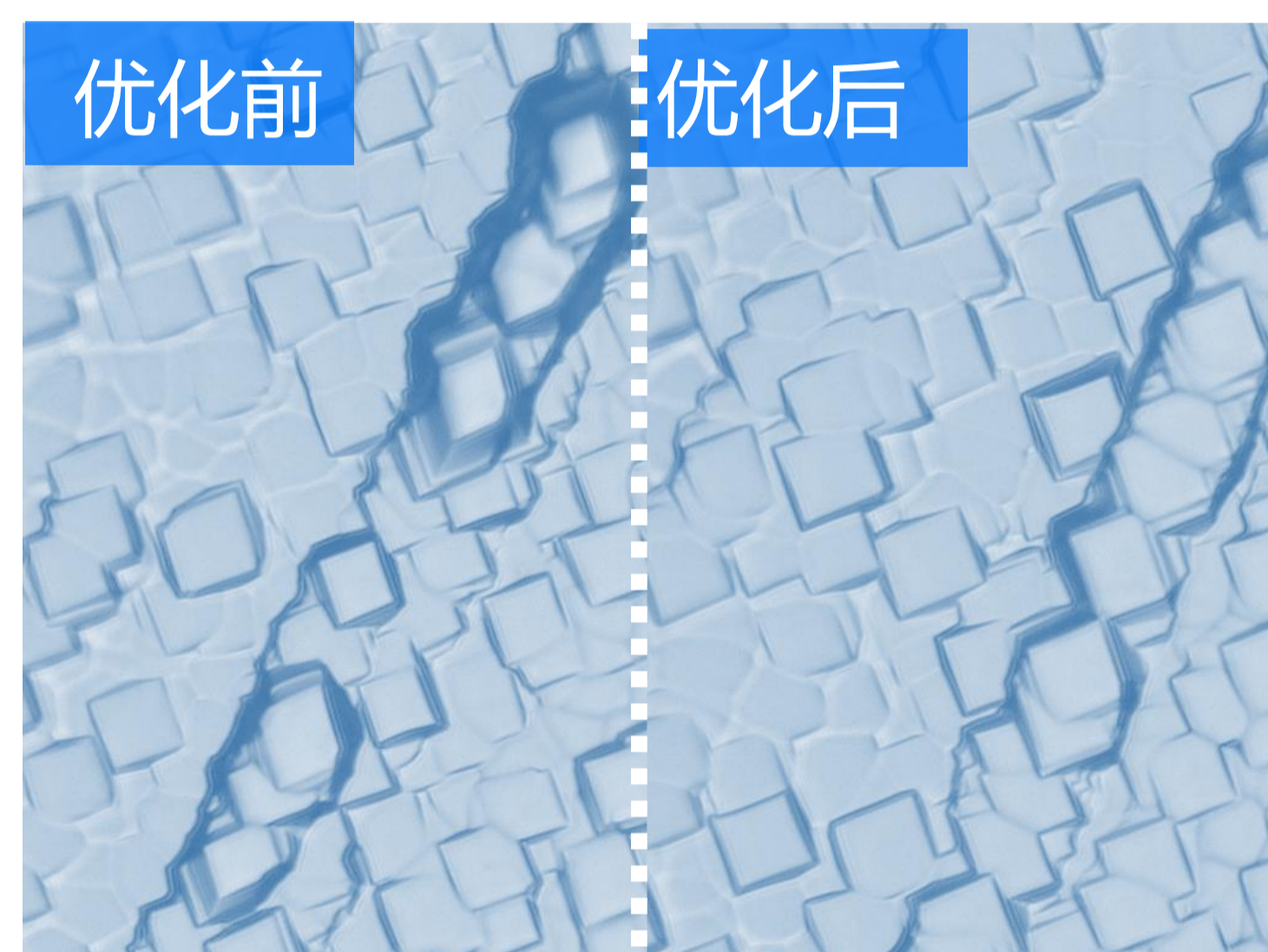
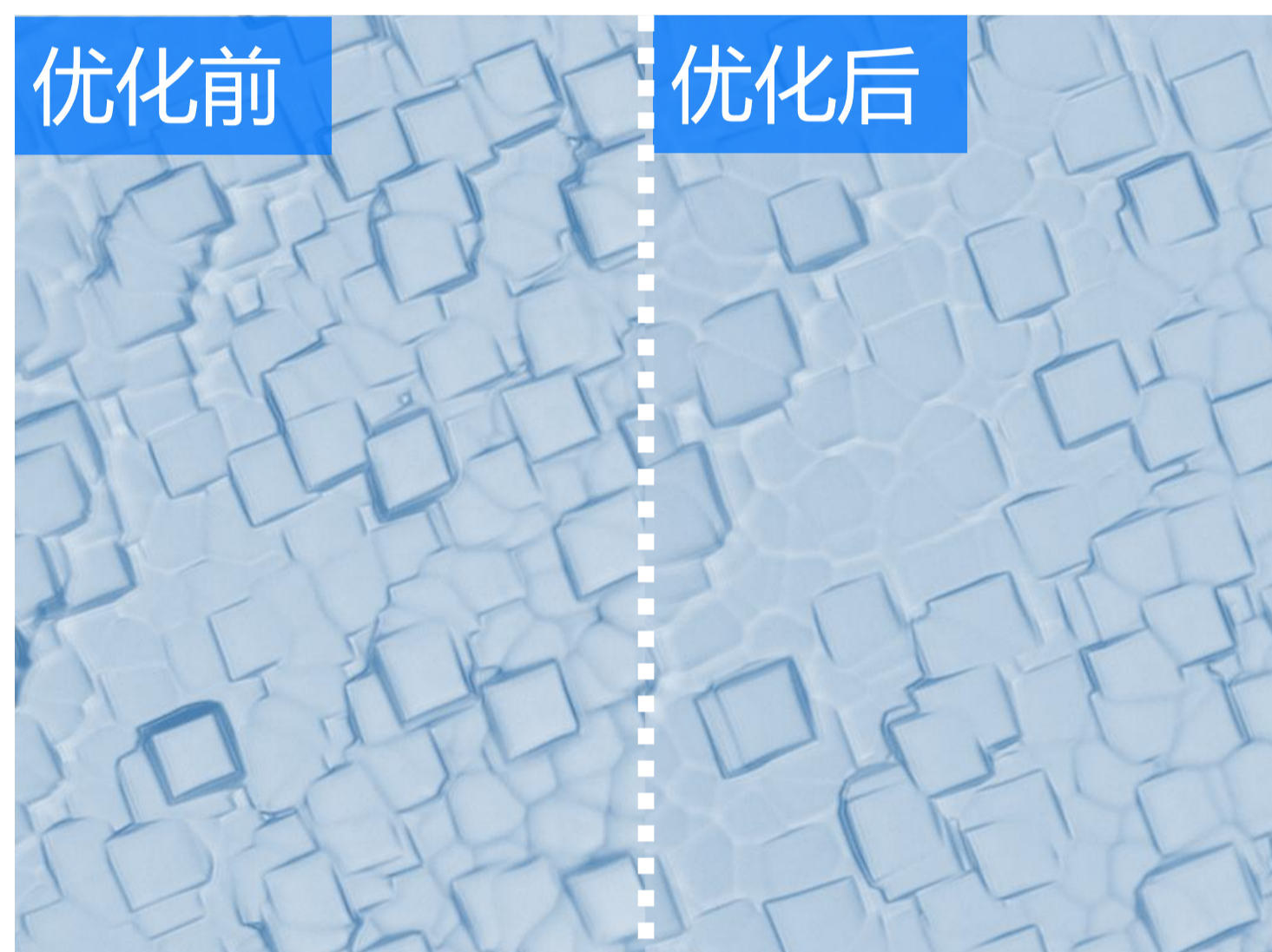


图1: 182尺寸硅片
减重0.21g绒面图
图2: 182尺寸硅片
减重0.25g绒面图

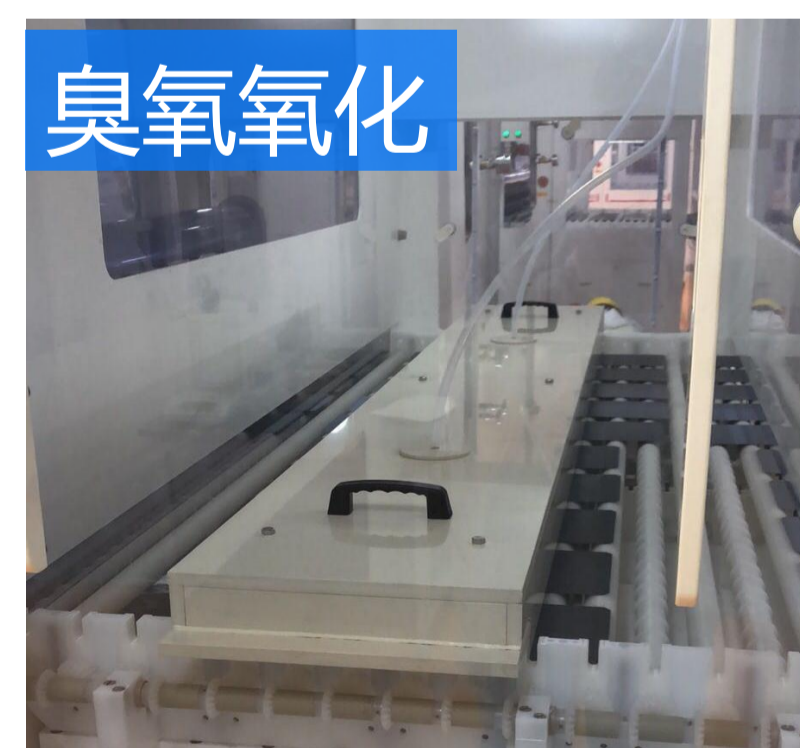
塔基平整均匀
加入叁峰碱抛添加剂优化后，塔基更平整均匀，
沟壑深度更浅，缝隙间距衔接更紧密



效率高
叁峰碱抛添加剂效率提升空间大并且生产周期较稳定

Item	Eta	Uoc	Isc	FF	IRev2	Rs	Rsh
BL对照组	22.88	0.6862	13.496	81.57	0.073	0.0018	663.12
SF实验组	22.89	0.6869	13.484	81.60	0.078	0.0018	667.21

适用性强
叁峰碱抛光添加剂适用于管式氧化、链式氧化及臭氧氧化，适用性强



去污能力强；
背面处理干净，具有更强的去污能力，更干净的碱抛效果。

塔基平整均匀；
碱抛光之后绒面平整，塔基衔接良好，沟壑深度更浅。

降低成本；
降低碱抛的后清洗浓度。

保护性强；
适用于管式氧化、链式氧化和臭氧氧化。